V. 85, N 3

JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY

MAY — JUNE 2018

СПЕКТРЫ ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ С МОНОСЛОЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ

С. Г. Моисеев 1,2* , И. А. Глухов 1 , В. А. Остаточников 1 , А. П. Анзулевич 3 , С. Н. Анзулевич 3

УДК 535.3;620.3;548.0

(Поступила 8 сентября 2017)

Методом Т-матриц рассчитаны спектры пропускания и отражения одномерной фотонно-кристаллической структуры со вставкой, представляющей собой монослой металлических наночастиц. Исследовано влияние параметров и местоположения монослоя на дефектные моды фотонной структуры.

Ключевые слова: наноплазмоника, фотонный кристалл, дефектная мода, локализация излучения.

The transmission and reflection spectra of a one-dimensional photonic crystal structure with an insert of a monolayer of metallic nanoparticles are calculated by the transfer-matrix method. The influence of the monolayer parameters and location on the defect modes of the photon structure is investigated.

Keywords: nanoplasmonics, photonic crystal, defect mode, field localization.

Введение. В последние годы особый интерес вызывают созданные на основе различных материалов фотонно-кристаллические структуры (ФКС) [1]. Вследствие периодической модуляции показателя преломления фотонный спектр этих структур обладает запрещенной зоной, в которой падающее излучение почти полностью отражается. Это свойство важно для практического применения, поскольку позволяет управлять оптическим излучением в системах передачи информации и в лазерной технике. Особое внимание уделяется структурам типа микрорезонатора Фабри—Перо, представляющим собой два брэгговских зеркала с дополнительным слоем между ними, нарушающим периодичность структуры [2—4]. Дефектный слой играет роль оптической микрополости (микрорезонатора), на которой можно локализовать поле световой волны, благодаря чему усиливаются эффекты взаимодействия излучения с веществом [5, 6]. Кроме того, посредством применения материалов и структур с управляемыми свойствами можно модифицировать фотонный спектр ФКС [7, 8].

В качестве материала микрополости фотонно-кристаллического резонатора предложено использовать металлодиэлектрические нанокомпозитные среды (трехмерные структуры), у которых в области плазмонного резонанса наблюдается сильная дисперсия оптических свойств [9—13]. Вместе с тем известно, что даже двумерные массивы (монослои) наночастиц (НЧ) характеризуется коэффициентами отражения и преломления, сравнимыми с такими коэффициентами для плоской границы раздела диэлектрических сред [14—17].

В настоящей работе показана возможность регулирования спектральными характеристиками ФКС за счет применения монослоя металлических НЧ сферической формы. Расчет спектров ФКС

SPECTRA OF THE PHOTONIC CRYSTAL STRUCTURE WITH A MONOLAYER OF METAL-LIC NANOPARTICLES

S. G. Moiseev ^{1,2} *, I. A. Glukhov ¹, V. A. Ostatochnikov ¹, A. P. Anzulevich ³, S. N. Anzulevich ³ (¹ Ulyanovsk State University, 42 L. Tolstogo Str., Ulyanovsk, 432017, Russia; e-mail: sergmoiseev@yandex.ru; ² Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk Branch, Ulyanovsk, Russia; ³ Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia)

¹ Ульяновский государственный университет,

^{432017,} Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42; Россия; e-mail: serg-moiseev@yandex.ru

 $^{^{2}}$ Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова Российской АН,

Ульяновский филиал, Ульяновск, Россия

³ Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

506 МОИСЕЕВ С. Г. и др.

выполнен на основе модифицированного метода матриц переноса (метода Т-матриц), в котором инородный интерфейс (в данном случае монослой НЧ) описывается матрицей с параметрами, определяемыми из его спектров отражения и пропускания.

Передаточные матрицы ФКС с монослоем НЧ. Оптические характеристики плоской границы раздела двух материальных сред определяются френелевскими коэффициентами отражения и пропускания. Поскольку массив НЧ, расположенных в одной плоскости, взаимодействует с электромагнитной волной подобно плоской границе раздела двух сред, он также может рассматриваться как интерфейс с некоторыми собственными коэффициентами отражения и пропускания. Таким образом, для расчета отражательной и пропускной способностей одномерной плоскослоистой структуры с внедренным монослоем НЧ может применяться метод матриц переноса, но с учетом специфики рассеяния электромагнитной волны на монослое НЧ.

Пусть в слоистой среде имеется *N* интерфейсов, включая монослои НЧ. Интерфейсы ориентированы перпендикулярно оси г системы координат. Пространство между интерфейсами заполнено однородными изотропными средами с различными диэлектрическими проницаемостями ε_i (i=1,...,N+1). Толщины соответствующих слоев L_i (j = 1, ..., N). Среды с диэлектрическими проницаемостями ε_1 и ε_{N+1} , которые прилегают к рассматриваемой структуре, являются полубесконечными.

На слоистую структуру в направлении оси z падает плоская монохроматическая волна с частотой ω и напряженностью электрического поля $E(z,t) \sim \exp(i\omega(t-z/c))$, которая вследствие переотражений на интерфейсах создает встречные волны во всех слоях структуры. Для описания парциальных волн введем следующие обозначения: $E(z_i^-)$ и $E(z_i^+)$ — напряженность поля слева и справа от интерфейса с номером і. Индекс f припишем волне, распространяющейся "вперед" (в направлении падающей волны), индекс b — волне, распространяющейся "назад". Согласно введенным обозначениям, на интерфейсе с номером s со стороны слоя с показателем преломления n_s напряженности полей распространяющихся навстречу другу волн $E_b(z_s^-)$ и $E_b(z_s^-)$. На том же интерфейсе со стороны слоя с показателем преломления n_{s+1} напряженности встречных волн $E(z_s^+)$ и $E_b(z_s^+)$.

Взаимосвязь полей на s-м интерфейсе (слева и справа от него) может быть представлена в виде матричного уравнения [18]:

$$\begin{pmatrix}
E_f(z_s^-) \\
E_b(z_s^-)
\end{pmatrix} = I_{s,s+1} \begin{pmatrix}
E_f(z_s^+) \\
E_b(z_s^+)
\end{pmatrix},$$
(1)

$$\begin{pmatrix}
E_{f}(z_{s}^{-}) \\
E_{b}(z_{s}^{-})
\end{pmatrix} = I_{s,s+1} \begin{pmatrix}
E_{f}(z_{s}^{+}) \\
E_{b}(z_{s}^{+})
\end{pmatrix},$$

$$I_{s} = \frac{1}{t_{s,s+1}} \begin{pmatrix}
1 & -r_{s+1,s} \\
r_{s,s+1} & t_{s,s+1}t_{s+1,s} - r_{s,s+1}r_{s+1,s}
\end{pmatrix},$$
(2)

где $r_{i,j}$, $t_{i,j}$ — амплитудные коэффициенты отражения и пропускания интерфейса, разделяющего среды с показателями преломления n_i и n_j , при падении световой волны со стороны среды с показателем преломления n_i . В случае плоской границы раздела сред коэффициенты $r_{i,j}$ и $t_{i,j}$ — френелевские амплитудные коэффициенты отражения и пропускания [19].

Взаимосвязь полей на двух соседних интерфейсах с номерами s-1 и s, ограничивающих однородный слой с номером $2 \le s \le N$, осуществляется передаточной матрицей одного слоя \hat{F}_s [18]:

$$\begin{pmatrix}
E_{f}(z_{s-1}^{+}) \\
E_{b}(z_{s-1}^{+})
\end{pmatrix} = \hat{F}_{s} \begin{pmatrix}
E_{f}(z_{s}^{-}) \\
E_{b}(z_{s}^{-})
\end{pmatrix},$$

$$\hat{F}_{s} = \begin{pmatrix}
\exp(i\delta_{s}) & 0 \\
0 & \exp(-i\delta_{s})
\end{pmatrix},$$
(3)

$$\hat{F}_s = \begin{pmatrix} \exp(i\delta_s) & 0\\ 0 & \exp(-i\delta_s) \end{pmatrix},\tag{4}$$

где $\delta_s = k_0 \sqrt{\epsilon_s} L_s$ — фазовая толщина слоя с номером s; $k_0 = \omega/c$ — волновое число в вакууме.

Применяя выражения (1)—(4) ко всей структуре, получаем взаимосвязь полей слева от первого интерфейса и справа от последнего интерфейса с номером N:

$$\begin{pmatrix} E_f(z_1^-) \\ E_b(z_1^-) \end{pmatrix} = \hat{G} \begin{pmatrix} E_f(z_N^+) \\ E_b(z_N^+) \end{pmatrix},$$
(5)

$$\hat{G} = I_1 F_2 I_2 F_3 \cdots F_N I_N \,. \tag{6}$$

Отметим, что в полубесконечной среде N с показателем преломления n_N (подстилающая среда) существует только прошедшая волна, поэтому в (5) следует полагать $E_b(z_N^+) = 0$.

Отражательная и пропускная способности структуры рассчитываются по формулам

$$T = \left| 1 / \hat{G}_{11} \right|^2, \qquad R = \left| \hat{G}_{21} / \hat{G}_{11} \right|^2.$$
 (7)

Спектры отражения и пропускания монослоя НЧ в области плазмонного резонанса. Численное моделирование. Для анализа свойств фотонной структуры с монослоем необходимо знать его амплитудные коэффициенты отражения и преломления. В настоящей работе расчет этих коэффициентов выполнен с помощью численного метода, реализованного в пакете программ физического моделирования COMSOL Multiphysics. Преимущество такой методики заключается в том, что она может быть распространена на метаслои из НЧ произвольной формы.

В качестве объекта моделирования рассмотрен упорядоченный монослой, в котором НЧ расположены в узлах квадратной решетки, лежащей в плоскости (xy). Радиус НЧ 2.5 нм, расстояние между их центрами (период структуры) ≥ 10 нм. Вектор напряженности электрического поля падающей волны, распространяющейся в направлении оси z (случай нормального падения), ориентирован параллельно одному из ребер элементарной ячейки монослоя. С целью минимизации требуемых ресурсов вычислительной техники с учетом симметрии внутренней структуры монослоя в качестве области моделирования выбрана четвертая часть его элементарной ячейки, как показано на рис. 1. Такая область содержит четверть объема НЧ и вдоль направления координатных осей x и y имеет размеры, равные половине периода монослоя. Для получения всего монослоя необходимо применить к изображенной на рис. 1 области операции отражения (для дополнения до ячейки со сферической частицей в ее центре), а затем трансляцию вдоль координатных осей x и y. Полученная таким образом структура представляет собой в плоскости (xy) двумерный массив НЧ с квадратной ячейкой.

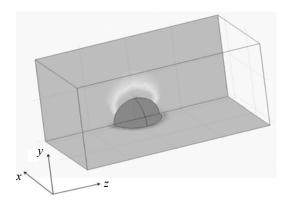


Рис. 1. Область моделирования в пакете Comsol Multiphysics; полутонами показано распределение интенсивности локального электрического поля электромагнитной волны

В качестве среды, в которой взвешен монослой НЧ, выбран непоглощающий материал с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_m = 2.25$. Для расчета диэлектрической проницаемости металлических НЧ использовано соотношение теории Друде [18]:

$$\varepsilon_{\rm p}(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \omega_{\rm p}^2/(\omega^2 - i\omega\gamma),$$
 (8)

где ω_p — плазмонная частота; ε_∞ — вклад решетки; γ — параметр релаксации. Для определенности при численном анализе в качестве материала НЧ рассмотрено серебро, для которого ε_∞ = 5, ω_p = $1.36 \cdot 10^{16}$ c⁻¹, γ = $3 \cdot 10^{13}$ c⁻¹ [20].

Результаты компьютерного моделирования оптических свойств монослоя НЧ серебра представлены на рис. 2. Видно, что в области поверхностного плазмонного резонанса НЧ (резонансная длина волны 435 нм) спектры отражения и пропускания монослоя претерпевают существенные изменения. Наблюдаемые амплитуды в резонансной области зависят от поверхностной концентрации НЧ: с уменьшением расстояния между НЧ (периода структуры) резонанс становится более выраженным, ширина резонансных кривых увеличивается, наблюдается частотный сдвиг резонанса в коротковолновую область. Полученные спектральные характеристики использованы для расчета элементов матрицы (2) монослоя НЧ.

508 МОИСЕЕВ С. Г. и др.

Спектральные характеристики ФКС с монослоем НЧ. Аналитический расчет с помощью метода Т-матриц. Рассмотрим слоистую структуру, в которой между двумя диэлектрическими (брэгговскими) зеркалами размещен композитный слой, состоящий из диэлектрической матрицы и монослоя металлических НЧ. Передаточная матрица такой структуры имеет вид:

$$N = [I_1 F_2 \cdots F_{2a+1} I_{2a+1}] [F_{m1} I_m F_{m2}] [I_{2a+3} F_{2a+4} \cdots F_N I_N] = M^a D \overline{M}^b, \tag{9}$$

где I_m — передаточная матрица монослоя НЧ; F_{m1} и F_{m2} — передаточные матрицы диэлектрических слоев, обрамляющих монослой; $D = F_{m1}I_mF_{m2}$ — предаточная матрица композитного слоя; M^a и M^b — передаточные матрицы диэлектрических зеркал, составленных из a и b бинарных слоев (при этом N = 2(a+b)+3). Местоположение монослоя задано соотношениями $L_{m1} = L_m/2 + \Delta$, $L_{m2} = L_m/2 + \Delta$, где L_m и Δ — толщина резонаторной области и смещение монослоя от ее центра (область толщиной L_{m1} расположена со стороны падения внешней электромагнитной волны).

Диэлектрические зеркала ФКС образованы парами слоев из изотропных диэлектриков с вещественными показателями преломления $n_{1,2} = \sqrt{\epsilon_{1,2}}$ и толщинами $L_{1,2}$. Толщины этих слоев $L_{1,2} = \lambda_0/4n_{1,2}$, где λ_0 — длина волны в вакууме, отвечающая центральной частоте фотонной запрещенной зоны. Зеркала разделяет резонаторная область, заполненная непоглощающим диэлектриком с показателем преломления $n_m = \sqrt{\epsilon_m}$. Рассмотрим случай, когда порядок следования слоев в M^b инвертирован по отношению к M^a .

Коэффициент пропускания для матрицы (9) с учетом вида матриц переноса для френелевских границ раздела и монослоя НЧ в случае симметричной структуры (a = b) можно записать в виде:

$$T = \left| \frac{1}{t_0} + \frac{r}{2n_m (1+r)} \left((A^2 - B^2) \cos \varphi_{\Delta} - (A^2 + B^2) \cos \varphi_m + i2AB \sin \varphi_m \right) \right|^{-2}, \tag{10}$$

где r — амплитудный коэффициент отражения монослоя НЧ ($R=|r|^2$); $t_0=2n_m/2AB\cos\varphi_m-i(A^2+B^2)\sin\varphi_m$ — амплитудный коэффициент пропускания ФКС без монослоя НЧ; $\varphi_m=(2\pi/\lambda)n_mL_m$ — набег фазы при однократном проходе через резонаторную область; $\varphi_\Delta=(2\pi/\lambda)n_m\Delta$ — набег фазы на расстоянии Δ между монослоем и серединой резонаторной области; $A=(m_{11}+m_{21})U_{a-1}(\rho)-U_{a-2}(\rho)$; $B=(m_{22}+m_{12})\times \times n_mU_{a-1}(\rho)-n_mU_{a-2}(\rho)$; $\rho=(m_{11}+m_{22})/2$; $U_j(\rho)=\sin[(j+1)\arccos\rho]/\sqrt{1-\rho^2}$ — полиномы Чебышева второго рода. Приведенные здесь величины выражаются через элементы матрицы периода брэгговских зеркал: $m_{11}=\cos^2\varphi-(n_2/n_1)\sin^2\varphi,\ m_{22}=\cos^2\varphi-(n_1/n_2)\sin^2\varphi,\ m_{21}=n_1n_2m_{12}=-i(n_1+n_2)\cos\varphi$ sin φ , где $\varphi=(2\pi/\lambda)n_1L_1=(2\pi/\lambda)n_2L_2$ — набег фазы в слоях диэлектрических зеркал.

В выражении (10) первое слагаемое под знаком модуля не зависит от параметров монослоя и определяет пропускную способность ФКС без НЧ: $T = |t_0|^2$ при r = 0. Остальные слагаемые, содержащие в качестве множителя отношение r/(1+r), определяют вклад НЧ. Наличие в (10) слагаемого, зависящего от ϕ_{Δ} , указывает на влияние местоположения монослоя НЧ на спектр пропускания структуры. Таким образом, спектр рассматриваемой ФКС оказывается зависящим как от параметров монослоя, так и от его местоположения. Рассмотрим эти зависимости более детально.

Для определенности примем толщину резонаторной области $L_m = \lambda_0/n_m$. Спектр такой структуры характеризуется наличием в фотонной запрещенной зоне дефектной моды на длине волны λ_0 . Распределение плотности электромагнитной энергии имеет локальный минимум (узел) в середине резонаторной области и два локальных максимума (пучности) в точках, равноудаленных на расстояние $L_m/4$ как от середины, так и от краев резонаторной области.

На рис. З показаны результаты расчета методом матриц переноса спектров пропускания и отражения ФКС типа $M^4D\,\bar{M}^4$ (a=b=4) в зависимости от местоположения монослоя НЧ серебра радиусом 2.5 нм. Резонаторная область ФКС выполнена на основе среды с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_m=2.25$. Центры соседних частиц монослоя удалены друг от друга на расстояния 20 и 10 нм. Такие монослои имеют спектральные характеристики, показанные на рис. 2 штриховой линией и штрихпунктиром. Брэгговские зеркала выполнены из материалов с диэлектрическими проницаемостями $\varepsilon_1=2.25$ и $\varepsilon_2=6.25$. Толщины слоев в составе зеркал $L_1=72.5$ нм, $L_2=43.5$ нм согласованы таким образом, чтобы длина волны λ_0 дефектной моды приходилась на длину волны локализованного поверхностного плазмонного резонанса НЧ (435 нм).

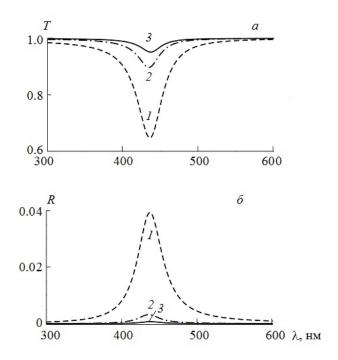


Рис. 2. Спектры пропускания (a) и отражения (δ) монослоя наночастиц серебра при нормальном падении световой волны; радиус НЧ 2.5 нм, период структуры 10 (I), 20 (Z) и 30 нм (Z)

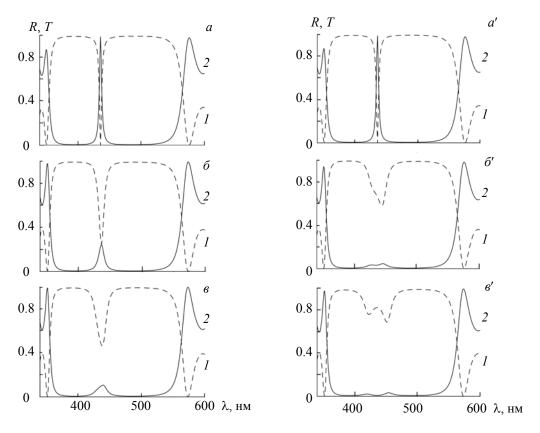


Рис. 3. Спектры пропускания (1) и отражения (2) ФКС при смещении монослоя на Δ = 0 (a, a'), 36 (δ , δ') и 72 нм (ϵ , ϵ'); радиус НЧ 2.5 нм, период структуры 20 (a— ϵ) и 10 нм (a'— ϵ')

510 МОИСЕЕВ С. Г. и др.

В центре рассматриваемой ФКС амплитуда поля близка к нулю (узел стоячей волны), поэтому для $\Delta=0$ (НЧ расположены в середине резонаторной области) монослой оказывается в области "электромагнитной тени" и его влияние на спектр структуры незначительное. Как следствие, при нахождении монослоя в центре ФКС спектры отражения и пропускания практически идентичны случаю ФКС без монослоя, а также сходны для монослоев разной концентрации (рис. 3, a и a'). Из выражения (10) следует, что в центре фотонной запрещенной зоны коэффициент пропускания принимает значение $T(\lambda_0) \approx |1 - n_m r/(1+r)|^{-2}$. Поскольку для рассматриваемых монослоев |Im r| << |Re r| << 1 (см. рис. 2), пропускание ФКС на дефектной моде остается высоким $(T(\lambda_0) \approx 1)$.

При размещении монослоя в области, где напряженность локального поля отлична от нуля, возникает электродинамическое взаимодействие в системе монослой— Φ KC, что приводит к модификации ее спектральных характеристик (рис. 3, δ и δ'). При смещении на расстояние $\Delta = L_d/4 \approx 72$ нм монослой оказывается в области наибольшей плотности электромагнитной энергии (пучность стоячей волны). При этом амплитуда волн, рассеянных монослоем, достигает максимума и, как следствие, влияние монослоя на спектр Φ KC становится наиболее сильным (рис. 3, ϵ). В случае монослоя с более плотной упаковкой НЧ может происходить расщепление дефектной моды (рис. 3, ϵ') подобно расщеплению дефектной моды в Φ KC со вставкой, выполненной из гетерогенных нанокомпозитных материалов [10, 21, 22]. Модификация дефектной моды (смещение, расщепление) происходит из-за переотражений и дополнительного набега фаз парциальных волн, возникающих из-за наличия "дефектного" (нарушающего периодичность) интерфейса структуры. При размещении монослоя НЧ в областях высокой локализации электромагнитной энергии диссипативные потери становятся настолько большими, что амплитуды дефектных мод существенно уменьшаются (рис. 3, ϵ и ϵ').

Заключение. Продемонстрирована возможность управления коэффициентами пропускания и отражения на дефектной моде фотонно-кристаллических структур за счет применения монослоя металлических наночастиц. Показано, что амплитуда дефектной моды существенно зависит от местоположения монослоя наночастиц. Зависимость спектральных характеристик фотонно-кристаллических структур от местоположения этого монослоя обусловлена неоднородностью распределения электромагнитного поля в резонаторной области. Наиболее сильная модификация спектров фотонно-кристаллических структур наблюдается при размещении монослоя наночастиц в области наибольшей локализации поля. Влияние монослоя сводится главным образом к уменьшению амплитуды дефектной моды, что обусловлено диссипативными потерями в металлических наночастицах. При высокой концентрации наночастиц также наблюдается расщепление дефектной моды.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проекты № 3.5698.2017/9.10, 3.8388.2017/ИТР, 14.Z50.31.0015) и Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 17-02-01382, 16-29-14045 офи м, 18-58-53055GFEN a).

- [1] K. Inoue, K. Ohtaka. Photonic Crystals: Physics, Fabrication and Applications, Berlin, Springer (2004)
- [2] **N. Ansari, M. M. Tehranchi, M. Ghanaatshoar.** Phys. B: Condens. Matter, **404**, N 8-11 (2009) 1181—1186
- [3] L. Bouaziz, K. Nachi, D. Gamra, M. Lejeune, A. Zeinert, K. Zellama, H. Bouchriha. Crystal. Res. Technol., **50**, N 1 (2015) 77—84
- [4] Tang Ru-Yi, Wu Jian-Wei, B. Nakarmi. Ouantum Electron., 46, N 7 (2016) 640—643
- [5] **J. Martorell, R. Corbalán.** Opt. Commun., **108**, N 4-6 (1994) 319—323
- [6] B. Shi, Z. M. Jiang, X. Wang. Opt. Lett., 26, N 15 (2001) 1194—1196
- [7] J. Luo, P. Xu, L. Gao. Solid State Commun., 152, N 7 (2012) 577—580
- [8] S. Ya. Vetrov, M. V. Pyatnov, I. V. Timofeev. Phys. Rev. E, 90, N 3 (2014) 032505
- [9] Y. Dadoenkova, I. Glukhov, S. Moiseev, V. Svetukhin, A. Zhukov, I. Zolotovskii. Opt. Commun., 389, N 15 (2017) 1—4
- [10] **С. Г. Моисеев, В. А. Остаточников.** Квант. электрон., **46**, № 8 (2016) 743—748 [**S. G. Moiseev, V. A. Ostatochnikov.** Quantum Electron., **46**, № 8 (2016) 743—748]
- [11] С. Г. Моисеев, В. А. Остаточников, Д. И. Семенцов. Письма в ЖЭТФ, 100, № 6 (2014) 413—417 [S. G. Moiseev, V. A. Ostatochnikov, D. I. Sementsov. JETP Lett., 100, N 6 (2014) 371—375]
- [12] S. Y. Vetrov, P. S. Pankin, I. V. Timofeev. Phys. Wave Phen., 23, N 1 (2015) 35—38

- [13] **Р. А. Карамалиев, Ч. О. Каджар.** Журн. прикл. спектр., **79**, № 3 (2012) 424—429 [**R. A. Karamaliyev, Ch. O. Qajar.** J. Appl. Spectr., **79**, № 3 (2012) 404—409]
- [14] **А. С. Шалин, С. Г. Моисеев.** Квант. электрон., **39**, № 12 (2009) 1175—1181 [**A. S. Shalin, S. G. Moiseev.** Quantum Electron., **39**, N 12 (2009) 1175—1181]
- [15] **А. С. Шалин, С. Г. Моисеев.** Опт. и спектр., **106**, № 6 (2009) 1004—1013 [**A. S. Shalin, S. G. Moiseev.** Opt. and Spectr., **106**, № 6 (2009) 916—925]
- [16] A. Monti, A. Alù, A. Toscano, F. Bilotti. Photonics, 2 (2015) 540—552
- [17] **А. П. Микитчук, К. В. Козадаев.** Журн. прикл. спектр., **83**, № 6 (2016) 947—952 [**A. P. Mikitchuk, K. V. Kozadaev.** J. Appl. Spectr., **83**, N 6 (2016) 996—1000]
- [18] C. C. Katsidis, D. I. Siapkas. Appl. Opt., 41, N 19 (2002) 3978—3987
- [19] **М. Борн, Э. М. Вольф.** Основы оптики, Москва, Наука (1970) [**M. Born, E. Wolf.** Principles of Optics, Oxford, Pergamon (1999)]
- [20] V. Yannopapas, A. Modinos, N. Stefanou. Opt. Quantum Electron., 34, N 1-3 (2002) 227—234
- [21] С. Я. Ветров, А. Ю. Авдеева, И. В. Тимофеев. ЖЭТФ, 140, № 5 (2011) 871—878
- [22] S. Moiseev, V. Ostatochnikov. Opt. Quantum Electron., 47, N 9 (2015) 3193—3200